

**EVG Releases Next Generation Automated Photoresist Processor for 200mm Wafers – December 8, 2022**

**EVG、200mmウェハ対応の次世代版自動フォトレジスト処理装置を発売**

2022年12月9日（金）14時56分 [マイナビニュース](#)

オーストリアEV Group(EVG)は、同社の自動レジスト処理装置「EVG 150」として、新たに最先端パッケージング、MEMS、高周波(RF)、3Dセンシング、パワーエレクトロニクス、フォトリソグラフィなどの次世代ニーズに対応する200mmウェハ対応の新モデルを発表した。

新モデルのEVG150 プラットフォームは、前世代プラットフォーム比で、最大80%のスループット向上、同約50%に縮小したフットプリントなどのほか、先端機能の追加と更なる機能の拡張を実現したとしている。

この次世代EVG150システムの最初の顧客は、EBS(Electronic Based Systems)の主要研究機関である「Silicon Austria Labs」で、同研究センターのマイクロシステム研究部門の責任者であるMohssen Moridi (モーセン・モリディ)氏は、「大手メーカーとの共同研究を通じて、Industrie 4.0、IoT、自動運転、サイバーフィジカルシステム(CPS)、人工知能(AI)、スマートシティ、スマートエネルギー、スマートヘルスの基盤を構築する重要な技術を開発している。EVGの次世代EVG150は、高い柔軟性を有しており、EBSのイノベーションを促進するために研究を進める顧客とともに、新たなプロセスと製品の大量生産の道を切り開くことに役立つ」と述べている。

## 関連記事（外部サイト）

- [トッパンフォトマスクとEVG、フォトリソグラフィ製造向けナノインプリントで協業](#)
- [EVG、ナノインプリント向けステップ&リピート・マスターの製造受託を開始](#)
- [EVG、300mmウェハ/2Gパネルに対応する量産対応ナノインプリント装置を発表](#)
- [EVG、顧客向けデバイス開発支援センターを開設](#)
- [EVG、バックエンドリソグラフィ向けマスクレス露光技術を開発](#)

[https://news.biglobe.ne.jp/it/1209/mnn\\_221209\\_2981669846.html](https://news.biglobe.ne.jp/it/1209/mnn_221209_2981669846.html)